

## 高濃度オゾン水によるレジスト除去技術

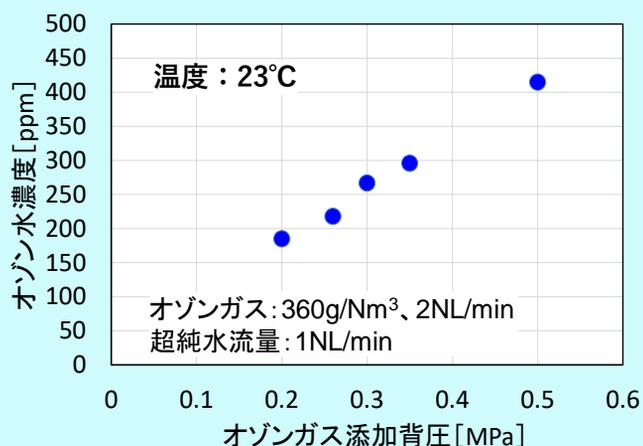
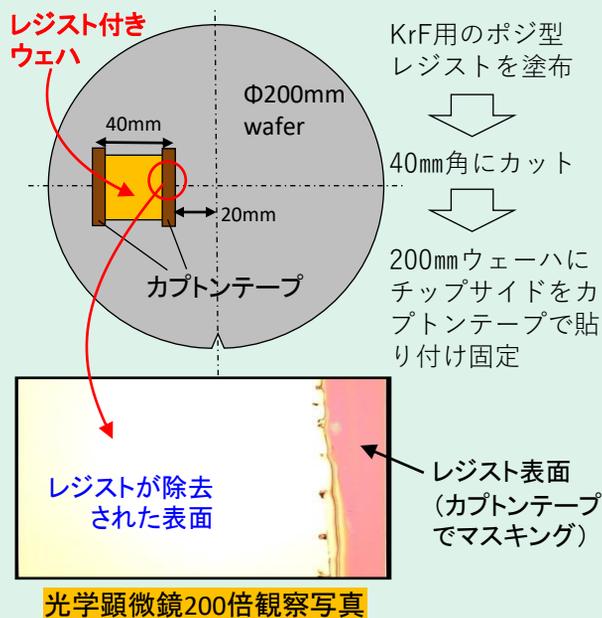
## レジスト除去

従来

新技術

硫酸  
+  
過酸化水素  
水溶液環境負荷  
が高い!!0.02%(200ppm)程度の  
温度制御した  
高濃度オゾン水

## 加圧溶解法によるオゾン水濃度

60°C以上に昇温した後も  
200ppm以上の高濃度オゾン水を実現

## オゾン水作成条件 ※

溶解方式	加圧溶解1Pass
薬液流量	1.0 L/min
オゾン水濃度	415 ppm
供給水温度	23 °C
タンク内圧力	0.5 M Pa
供給オゾンガス濃度	360 g/m <sup>3</sup>
オゾンガス流量	2 NL

レジスト剥離 処理条件	ノズル出口 オゾン水濃度 (KI法) [ppm]	結果	推定レジスト 剥離レート [nm/min]
23°C 70sec	415	全剥離	857

800nm/minを超える  
レジスト除去性能を実現!!

この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業の結果得られたものです。